# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

58-194834

(43)Date of publication of application: 12.11.1983

(51)Int.CI.

CO7C 49/403 C07C 45/82 CO7C 45/86

(21)Application number: 57-103110

(71)Applicant:

TOKYO OHKA KOGYO CO LTD

(22)Date of filing:

(72)Inventor:

KOMATSUBARA YUKIO

**KUDOU TOMOYA** 

#### (54) PURIFICATION OF CYCLOHEXANONE

#### (57)Abstract:

PURPOSE: To obtain the titled compound useful as a constitutional component for ink for ink jetting recording, not producing adipic acid, etc., by adding an antioxidant to cyclohexanone, subjecting it to distillation under reduced pressure in an inert gas atmosphere so that cyclohexanone is purified.

CONSTITUTION: An antioxidant is added to cyclohexanone on the market, and the mixture is distilled in an inert gas atmosphere such as N2 under reduced pressure, preferably ≤100mmHg, so that cyclohexanone is purified, to give cyclohexanone having ≤10µg/ml active oxygen content, slightly producing an acidic substance such as adipic acid, etc. A phenolic compound and an amine-based compound are used as the antioxidant, 2,4,6-Tri-tert-butylphenol, etc. is used as the phenolic compound. and phenyl-α-naphthylamine, etc. as the amino-based compound. The amount of the antioxidant is preferably 0.05wt% based on cyclohexanone.

#### **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of

rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

# (19) 日本国特許庁 (JP)

①特許出願公開

# ⑩公開特許公報(A)

昭58—194834

Mint. Cl.3

識別記号

庁内整理番号 7824-4H 7824-4H

43公開 昭和58年(1983)11月12日

発明の数 審査請求 未請求

(全 4 頁)

C 07 C 49/403 45/82 45/86

7824-4H

のシクロヘキサノンの精製方法

一104号

②特 願 昭57-103110 @発 明者 工藤知哉

砂代

砂出 願 昭57(1982)5月10日 62特 願 昭57-76588の分割

神奈川県高座郡寒川町一之宮23 74-2

明 小松原幸雄 ⑫発 者

仍出 願 人 東京応化工業株式会社

茅ケ崎市松ケ丘2丁目2番地58

川崎市中原区中丸子150番地 人 弁理士 井坂實夫、

钳

発明の名称

シクロヘキサノンの精製方法

特許請求の範囲

シクロヘキサノンに酸化防止剤を添加し、この 混合物を不活性ガス雰囲気中において被圧蒸留す ることを特徴とするシクロヘキサノンの精製方法。

発明の詳細な説明

(発明の技術分野)

本発明はシクロヘキサノンの精製方法に関する ものである。詳しくいえば本発明は、酸紫の作用 を受けてもアジピン酸などの酸性物質を生成しに くいシクロヘキサノンを得る方法に関するもので

(発明の技術的背景)

高沸点溶剤としてしばしば使用される市販のシ クロヘキサノンは、空気と接触することによつて 酸化されてn-パレリアン酸、アジピン酸、n-カプロン酸などを生成する傾向がある。こうして アジピン酸などの酸性物質を含有するにいたつた

シクロヘキサノンは、その本来の使用目的に対し て障害を及ぼすことがある。たとえばインクジェ ット記録用インクの構成々分として市販のシクロ ヘキサノンを使用すると、該インクの貯蔵中ある いは使用中にシクロヘキサノンが酸化されてアジ ピン酸などの酸性物質を生成し、こうして生成し たアジピン酸などの酸性物質は、インク中に導電 性物質として配合されている無機塩と反応してア ジピン酸塩などを形成し、このアジピン酸塩など が不溶解性であるために析出する。析出したアジ ピン酸塩などは、インク循環系中においてインク の円滑を流れを阻害し、印字品質の悪化を招来す 3.

(先行技術)

上記のとおりであるから、アジピン酸などの酸 性物質を生成してくいシクロヘキサノンの出現が 符望されていたのであるが、そのようなシクロへ キサノンを得る方法は未だ公開されていない。

(発明の目的)

発明者らは前記の現況に立脚して、アジピン酸

などの酸性物質を生成してくいシクロヘキサノンを得る方法を開発することを目的として研究し、 本発明に到達した。

#### (発明の構成)

本発明者らは鋭意研究を重ねた結果、活性酸素含有量が10 18/ml 以下のシクロヘキサノンであれば酸素と接触してもアジピン酸などの酸性物質を生成する傾向が極度に小さく、したがつてインクジェット記録用インクを構成するために適当であること、およびこのようなシクロヘキサノンは、市販のシクロヘキサノンに酸化防止剤を添加し、この混合物を不活性ガス雰囲気中で減圧蒸留すれば得られることを知得した。

したがつて本発明は、市販のシクロヘキサノンに酸化防止剤を添加し、この混合物を不活性ガス雰囲気中で減圧蒸留することによつて、活性酸累含有量が10 1/9/ml 以下であるシクロヘキサノンを得る方法である。

本発明の構成および関連事項について以下に詳説する。

-3-

本発明の方法において用いられる不活性ガスとしては、通常知られている窒素、ヘリウム、アルゴン、キセノンなどのガスを使用することができるが、工業的に使用する場合には窒素が好適である。

## (酸化防止剤)

本発明において使用することのできる酸化防止削には、フェノール系化合物とアミン系化合物がある。

フェノール系化合物 としては 2 , 6 - ジーlert - プチルー 4 - メチルフェノール、 2 , 4 , 6 - トリー tert - プチルフェノール、スチレン化フェノール などのアルキルフェノール 類、 2 , 2 ' - メチレン・ピスー ( 4 - メチルー 6 - tert - プチルフェノール )、ピスフェノール A、4,4' - プチリデンーピス ( 6 - tert - プチルー 3 - メチル) フェノール、 1 , 1 - ピスー ( 4 - ヒドロキシフェニル ) シクロヘキサンなどのモノアルキレンジアルキルフェノール類、 2 , 6 - ピスー ( 2' - ヒドロキシー 3' - tert - プチル-5'

(活性酸素)

本発明におけるシクロヘキサノン中の活性酸素 含有量とは、下記の測定方法および計算式にした がつて計算される数値である。

容量 5 0 ml の活径 付き 三角 フラスコに あらか じめ入れた酢酸 - クロロホルム (2+1)35 ml 中に、試料 (シクロヘキサノン)2 ml を添加し、次に 5 0 を ョウ化カリウム水溶液 0.2 ml を添加した後、フラスコの気相部を 3 まガスで 10 挽し、 密栓して 3 0 分間室 温で放 10 する。 放 10 後 1 0 0 ml ピーカーに 液を移し、メタノール 3 0 ml を加えた後、N / 1 0 0 チオ 硫酸 ソーダに より 簡定して 遊離 されたョウ素量を求める。 シクロヘキサノン 2 ml 中に 含有される活性酸素量は次式により計算される。

活性酸素含有量 (μ9)=80×f×(Λ-B)

ただし上式中の文字は、下記の意味を有する。

f: N/100チオ硫酸ソーダ溶液の力価

Λ:滴定に要したN/100チオ硫酸ソーダ溶液(ml)

B:空試験の滴定に要したN/100チオ硫酸ソーダ溶液 (不活性ガス)

-1-

- メチルベンジル) - イ - メチルフエノールなどのジアルキレントリアルキルフエノール類、2,2' - チオピス- (イ - メチル - 6 - tert - プチルフエノール)、イ、イ' - チオピス - (3 - メチル - 6 - tert - プチルフエノール) などのピスフエノールモノサルフイド類を挙げることができる。

アミン系化合物としてはフェニルーαーナフチルアミン、フェニルーβーナフチルアミン、N,N'ージフェニルーpーフェニレンジアミン、N,N'ージーβーナフチルーpーフェニレンジアミン、NーシクロヘキシルーN'ーフェニルーpーフェニレンジアミン、pーヒドロキシージフェニルアミン、pーヒドロキシフェニルーβーナフチルアミン、2,2,4ートリメチルー1,2ージヒドロキノリンなどを挙げることができる。

これらの酸化防止剤は単独または混合して使用することができるが、シクロヘキサノンに対して少なくとも 0.0 5 重量 8 添加することが望ましく 0.5 重量 8 以上添加した場合には、その効果は飽

和状態となるので多量に添加する必要はない。

#### (蒸留条件)

シクロヘキサノンの挑点は155.6 じであるの て、蒸留のときには彼圧下で蒸留することが溜ま しく、100℃以下にして蒸留できるように100 mall 9 程度以下に放圧することが好ましい。

#### ( 実施例および比較例)

本発明をさらに理解しやすくするために、本発 明の実施例および比較のための比較例を以下に記 述するが、下記の実施例は本発明を制限するもの てはない。

#### 実施例1

20 4の蒸留フラスコに市販のシクロヘキサノ ン ( 東亜合成化学工業株式会社製 ) 1 5.5 Kg、酸 化防止剤の2 . 4 . 6 - トリー teri - プチルフ エノール239を入れ、窒累ガスを導入し、フラ スコ内の空気を窒累ガスで随換し、15 mall 9 に して減圧蒸留した。

その結果、シクロヘキサノンの活性酸素含有量 を26μ8/ml から3μ9/ml に降下させることがで

-- 7 ---

あつた。

### 比較例3

実施例2 において使用したのと同じンクロヘキ サノンに酸化防止剤を添加しない以外は実施例2 と同様に処理し、留出したシクロヘキサノンの活 性酸累含有量を測定したどころ、第1 表中の実験 番号4の行に示すとおり15/18/11であつた。

きた。

#### 実施例2

実施例1と同じシクロヘキサノン17kgに2, 4 , 6 - 1 1 - tert - プチルフェノール 2 0 8 を添加して、その混合物を與施例」に単じて波圧、 蒸留した。蒸留条件および活性酸累含有量を後記 第 1 表中の実験 番号 1 の行に示す。 活性酸素含有 量は4/18/ml まで減少した。

#### 比較例1

前記の実施例1および実施例2において使用し た市販のシクロヘキサノンを蒸留しないで、その まま活性酸紫含有量を測定した。その結果を第1 表中の実験番号2の行に示す。活性酸素含有量は 2 6 118/ml であつた。

#### 比較例2.

実施例1において使用したのと同じシクロヘキ サノンに酸化防止剤を添加しないで、窒素気流中 で15mll9 のもとに90℃までに留出する留分 を集めた。この留分の活性酸素含有量は、第1 殺 中の実験番号3の行化示すとおり17 118/ml で

-8-

本語   大田   大田   大田   大田   大田   大田   大田   大	空試験 商 5 商 6 0.2 5㎡ 0.3 5 0.2 5㎡ 0.9 0	
	商元量 平均值 0.25㎡ 0.35 ㎡ 0.25元 0.90 ㎡	
<u> </u>	0.25m2 0.35 m2	
未 蔡 留 品 0.90ml 0.90ml 0.25ml 0.90 ml ask 中 90 C まで A 25ml 0.60ml 0.75ml 0.25ml 0.675ml 1.5ml 8	0.25т. 0.90 т.	
超素中90℃ まで禁留 0.60ml 0.75ml 0.25ml 0.675ml 1.5mHl/9		
		25)/2 1749/m2
盤束中75℃ 4 まで菜留 0.60ml 0.65ml 0.625ml 8 15mH9	0.2 5m£	25)/2 1549/m2
(注) 第1 張中のBHTは、2,4,6-	T II, 2, 4,	- ブチル

--209--

-9-

-10-

# 特開昭58-194834 (4)

上記案材を第2要に示す組成に従つて配合して 密解後、フロロポアフィルター(孔径2ヵm、住友 電工佛製)で沪過し、4種のインクジェット記録 用インクを調製した。 安中の配合量の数値は重量 部である。

表中、参考例1 および参考例3 は未処理のシクロヘキサノンを使用し、参考例2 および参考例4 は、酸化防止剤を添加し、 雲楽雰囲気中で減圧蒸留したシクロヘキサノンを使用した。

( 参考例 )

本発明によつて得られた精製シクロヘキサノンを使用して構成したインクジェット記録用インクと、市販のシクロヘキサノンを使用して構成したインクジェット記録用インクについて、それらの性能を比較した。

参考例において使用した絮材は、次のとおりである。

(1) 溶 剤

シクロヘキサノン

東亜合成化学工業(物製

エタノール

今津菜品做製

(2) バインダー

スミライトレジンPR-51369F 住友 ジュレズ(特製

(3) 導電性附与剤

チオシアン酸ナトリウム

純正化学㈱製

硝酸リチウム

関東化学御製

(4) 染 料

オイルプラツクHBB

オリエント化学工業(物製

(5) 界面活性剤

信越シリコーンKp-340 信越化学工業㈱製

-11-

第 2 表

		参考例1	参考例2	参考例3	参考例4
溶剤	シクロヘキサノン	60	60	60	60
	エタノール	3 3	3 3	3 4	3 4
パインダー	スミライトレジン PR-51369ド	4	4	4	4
導電性	チオンアン酸ナトリウム	0	0	0.9	0.9
附与剂	硝酸リチウム	1. 9	1. 9	0	O
染料	オイルプラツクHBB	1	1	1	1
界 面 活性剤	信越シリコーン Kp-340	0. 1	0. 1	0.1	0.1
用いたシクロヘキサノンの 活性酸素含有量(μg/ml)		2 6	3	26	3
アジピン酸塩の存在		6ヶ月後 析 出	1年後	6ヶ月接 析 出	1年後

-ı2-

参考例2のインクジェット記録用インクを、日立「Jプリンター(P-610型)に適用して、長期安定性テストを行つたが、循環系をつまらせることがなく、印字品質においても非常に良好な結果を得た。参考例4のインクジェット記録用インクについても同様のテストをして、同様の結果を得た。

## (発明の効果)

上記の契施例かよび比較例によつて理解されるように、本発明の精製方法によればシクロヘキサノン中の活性酸素含有量を10 μ8/ml 以下に低下させることができ、ひいては本発明によつて得られるシクロヘキサノンを使用すれば、長期間にわたつて安定性を保持するインクジェット配母用インクを製造することができる。

出 願 人 東京応化工業株式会社

代理人 弁理士 井 坂 實 夫